

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Handayani, N. (2007). *Analisis XRD Film Tipis $Al_xGa_{1-x}N$ diatas silikon (111) yang ditumbuhkan dengan Metode DC Magnetron Sputtering*. Skripsi pada FMIPA UNNES: diterbitkan.
- Amin, N. (2007). *Analisis Sifat Listrik Persambungan M-S-M pada film tipis $Al_xGa_{1-x}N$ yang ditumbuhkan diatas Substrat Silikon (111) dengan Metode DC Magnetron Sputtering*. Skripsi pada FMIPA UNNES: diterbitkan.
- Ariadi, E. (2006). “ Studi Penumbuhan Lapisan Ta_2O_5 dengan metode DC Magnetron Sputtering untuk Lapisan Oksida dalam Struktur Metal-Oksida-Semikonduktor $Al/Ta_2O_5/GaN$.” Skripsi pada FPMIPA UNNES: diterbitkan.
- A. R. Raju, K. Sardar, C. N. R. Rao, Mater. Sci. Semicond. Proc. 4 (2001)
- Firdaus, F. (2009). *Pengaruh Molaritas Ga_2O_3 dan Laju Aliran Gas N_2 Terhadap Karakteristik fisis film tipis GaN yang ditumbuhkan dengan Metoda Sol-gel menggunakan teknik spin coating*. Skripsi pada FPMIPA UPI Bandung: tidak diterbitkan.
- Fong Kwong, Y. (2007). “*The Study of GaN Materials for Device Applications*”. Tesis pada Universiti Sains Malaya: diterbitkan.
- Green, B M. (2001). *Characteristics, Optimization and Integrated Circuit Application of Alumunium Gallium Nitride / Gallium Nitride High Electron Mobility Transistor, (Disertation)*. Skripsi pada Faculty of the Graduate School of Cornell University USA (18-20): tidak diterbitkan.
- Hasanah, L. et al. (2003). “Studi Pengaruh Rasio V/III Terhadap Morfologi Permukaan Film Tipis GaSb yang ditumbuhkan dengan Metode MOCVD Reaktor Vertikal”. Jurnal Matematika dan Sains. 8, (3), 107-109.
- Irzaman. et al. (2010). “Uji Konduktivitas Listrik dan Dielektrik Film Tipis Lithium Tantalate ($LiTaO_3$) yang didadah Niobium PentaOksida (Nb_2O_5) menggunakan Metoda Chemical Solution Deposition”. Prosiding Seminar Nasional Fisika 2010. 175-183.
- Karim, S. dkk. (2005). “Rancang Bangun Alat Spin Coating Sederhana untuk Penumbuhan Lapisan Tipis Semikonduktor”. Laporan Akhir Penelitian Dana Rutin UPI Tahun Anggaran 2005.

- K. Sardar, A. R. Raju, G. N. Subbanna. (2003). “*Epitaxial GaN films deposited on sapphire substrates prepared by the sol-gel method*”. Solid state Communications 125
- Kurniawan, Iwan. (2005). *Karakterisasi Sifat Fisis Film Tipis Galium Arsenat (GaAs) yang ditumbuhkan dengan Metode MOCVD*. Skripsi pada FPMIPA UPI Bandung: tidak diterbitkan.
- Lee, Dae-Sik et al. (2002). “GaN Thin Film as Gas Sensors, Sensors and Actuators B 89 (2003) 305-310”.
- Abdullah-Khairurrijal, M. (2010). “Karakterisasi Nanomaterial Teori, Penerapan, dan Pengolahan Data”. Bandung: CV. Rezeki Putra Bandung.
- Pankove, I. J. and Moustakas, T. (1998). *Gallium Nitride (GaN) I Semiconductors and Semimetals*. America Academic press.
- Permadi, Gian. (2008). *Pengaruh Tekanan Parsial Gas N₂ terhadap struktur kristal dan morfologi film tipis GaN yang ditumbuhkan dengan Metode PLD*. Skripsi pada FPMIPA UPI Bandung: tidak diterbitkan
- Rusdiana, et al. (2001). “Penumbuhan Film Tipis GaN di Atas Substrat Sapphire dengan Teknik Sol-gel Spin Coating”.
- Sulastri, Eko. (2006). “Studi Pengaruh Rasio Laju Alir Gas Argon Dan Nitrogen Terhadap Sifat Optik Film Tipis Gallium Nitrida Yang Ditumbuhkan Dengan Metode DC Magnetron Sputtering. Semarang”. Skripsi pada FMIPA UNS: tidak diterbitkan.
- Sutanto, H. (2001). “Pengaruh Variasi Temperatur Penumbuhan Terhadap Karakteristik Sifat Listrik Film Tipis GaN di atas Si (111) dengan Metode PA-MOCVD”. *Berkala Fisika*. 4, (2), 40-44.
- Sutanto, H. et al. (2005). “Pengaruh Laju Aliran Gas Nitrogen Terhadap Intensitas Emisi Optik Plasma Nitrogen yang dibangkitkan oleh Gelombang Mikro 2,45 GHz dengan Metode Optical Emission Spectroscopy”. *Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Teknologi Akselerator dan Aplikasinya*. 7, 22-28.
- Sutanto, H. et al. (2006). “Karakterisasi Struktur dan Listrik Film Tipis GaN yang ditumbuhkan diatas Substrat Si (111) dengan Metode Plasma Assisted-

Metalorganic Chemical Vapor Deposition (PA-MOCVD)”. Jurnal Matematika dan Sains. 11, (1), 12-17.

Sutanto, H. *et al.* (2008). “Penumbuhan Lapisan Tipis Semikonduktor GaN diatas Substrat Silikon dengan Metode Sol-Gel”. Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Kimia dan Proses 2008.

Tipler, Paul. (1991). *Fisika Untuk Sains dan Teknik Jilid 1* (third ed.). Jakarta: Erlangga.

Widiyandari-Budiman, H. (2004). “Pengaruh Laju Aliran Gas N₂ terhadap Sifat Optik Film Tipis GaN yang ditumbuhkan dengan Teknik Pulsed Laser Deposition (PLD)”. Berkala Fisika. 7, (1), 28-34.

Widuri, U. (2007). *Pengaruh Tekanan Gas Argon pada Penumbuhan Film Tipis Ga₂O₃ Doping Mn dengan menggunakan metode DC Magnetron Sputtering*. Skripsi pada FPMIPA UNNES Semarang: diterbitkan.

Y. C. Lee, Z. Hassan, F. K. Yam, M. J. Abdullah, K. Ibrahim, M. Barmawi, Sugianto, M. Budiman, P. Arifin. (2005). “A comparative study of the electrical characteristics of metal semiconductor-metal (MSM) photodiodes based on GaN grown on silicon”. *Applied Surface Science*.